



ナノテクノロジー ・ネットワーク プロジェクト

Nanotechnology
Network Japan

文部科学省のナノテクノロジー・ネットワークプロジェクトの一環として、広島大学と山口大学の連携でシリコンナノ加工と高品質真空利用に関する支援を行います。

Hiroshima University and Yamaguchi University cooperate to support the “Nano-Foundry Support for Silicon Nano-structures and High Quality Vacuum Technology” as a part of the “Nanotechnology Network Japan” which was started by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

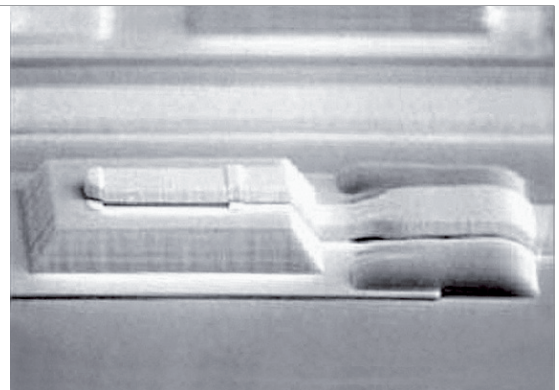


ナノテクノロジー・ネットワーク
プロジェクト
Nanotechnology Network Japan

教授 福山正隆 (客員)
Prof. M. Fukuyama

広島大学の支援の特徴は保有する30nm以下のシリコンベース微細加工技術、極浅接合形成技術、超微細デバイス技術、微細トランジスタを設計から試作・評価まで可能、電子線描画、イオン注入、CVD、スパッタ、酸化拡散炉、ドライエッチング等の装置を保有しております。

The special features of Hiroshima University support program are special technologies to fabricate ultra-small Si MOS transistors with a gate length of a few tens of nano-meters using electron-beam lithography machine, ion implanter, CVD apparatus, sputter deposition, oxidation and diffusion furnaces, ICP and ECR etchers, etc.



新技術でSiドライバーICに接合された薄膜LED
(株) 沖デジタルイメージングへの共同研究
(2007年「ものづくり大賞」優秀賞受賞)

Oki Digital Imaging Corporation: Epitaxial film LED array bonded on the Si driving IC chip (Prime Minister's Award, Japan Prize Creativity in 2007)

中国・四国、九州地方をカバーする幅広い（シリコン+非シリコン系、バイオ融合）ナノテク微細加工支援
Nano-Foundry Support for Silicon Nano-structures and High Quality Vacuum Technology

広島大学

Hiroshima University

- シリコンを中心とする半導体微細加工技術に対する支援
Nano-foundry support for silicon nano-structures
- 半導体・バイオ融合技術に関する支援
Support for integration of semiconductor and biotechnology
- 半導体技術者育成教育
Education for LSI engineers

山口大学

Yamaguchi University

- 非シリコン系を中心とする微細加工支援
Nano-foundry support for non-silicon structures
- 高真空利用技術を有効活用
Support for the use of high quality vacuum technology
- 真空工学・マイクロ加工技術者育成支援
Education for engineers of vacuum and microfabrication technologies

